

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-279447  
 (43)Date of publication of application : 26.10.1993

(51)Int.Cl. C08G 18/61  
 B01D 71/54  
 C08G 18/44

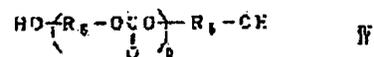
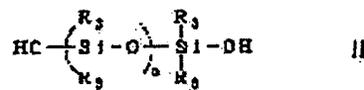
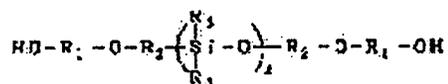
(21)Application number : 04-077338 (71)Applicant : MITSUBISHI RAYON CO LTD  
 (22)Date of filing : 31.03.1992 (72)Inventor : KAWAI YOSHIO  
 KAMO JUN

## (54) SILICON-BASED BLOCK COPOLYMER AND MEMBRANE MADE THEREOF

(57)Abstract:

**PURPOSE:** To obtain a new copolymer giving a separation membrane having high gas transmission coefficient by reacting two kinds of siloxanediols with a diisocyanate and a carbonate diol.

**CONSTITUTION:** The objective block copolymer is produced by using (A) a siloxanediol of formula I (R1 and R2 are bivalent hydrocarbon group; R3 is methyl or phenyl; (1) is ≥8), (B) a siloxanediol of formula II ((m) is ≥8), (C) a diisocyanate of formula III (R4 is aliphatic group, alicyclic group or aromatic group) and (D) a carbonate diol of formula IV (R5 is aliphatic group; (n) is ≥3) as starting raw materials, dissolving the component C in an organic solvent, reacting with the component A and the component B in nitrogen gas stream and finally adding and reacting the component D to the above reaction product.



(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-279447

(43)公開日 平成5年(1993)10月26日

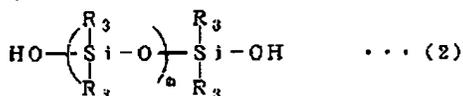
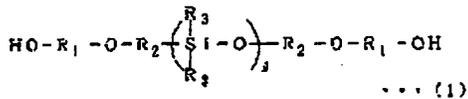
(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 G 18/61	NEM	8620-4J		
B 0 1 D 71/54		8822-4D		
C 0 8 G 18/44	NDW	8620-4J		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号	特願平4-77339	(71)出願人	000006035 三菱レイヨン株式会社 東京都中央区京橋2丁目3番19号
(22)出願日	平成4年(1992)3月31日	(72)発明者	河合 英穂 広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨ ン株式会社中央研究所内
		(72)発明者	加茂 純 広島県大竹市御幸町20番1号 三菱レイヨ ン株式会社中央研究所内

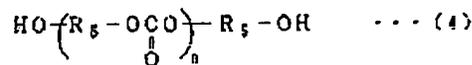
(54)【発明の名称】 シリコン系ブロック共重合体及びそれからなる膜

(57)【要約】 (修正有)  
【構成】 一般式(1)で示されるシロキサジオール



OCN-R<sub>4</sub>-NCO..... (3)

(式中R<sub>4</sub>は脂肪族基、脂環族基もしくは芳香族基を表  
す)及び一般式(4)で示されるカーボネートジオール



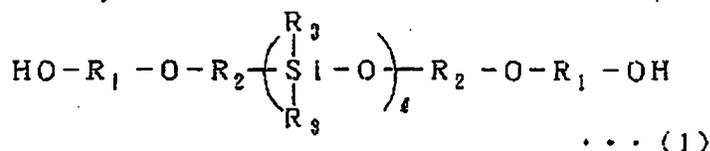
(式中R<sub>5</sub>は脂肪族基, nは3以上の整数を表す)を反  
応させて得られるウレタン結合を有するシリコン系ブロ  
ック共重合体, 及び選択透過膜。

【効果】 気体透過係数の大きな分離膜が得られる。

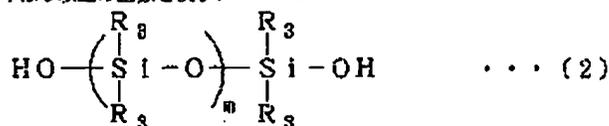


(3)

特開平5-279447



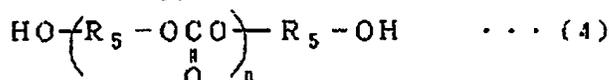
(式中R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>は二価の炭化水素基, R<sub>3</sub>はメチル基もしくはフェニル基, lは8以上の整数を表す) \*【化6】



(式中R<sub>1</sub>はメチル基もしくはフェニル基, mは8以上の整数を表す)及び一般式(3)で示されるジソシアネート



(式中R<sub>1</sub>は脂肪族基, 脂環族基もしくは芳香族基を表す)及び一般式(4)で示されるカーボネートジオール【化7】



(式中R<sub>1</sub>は脂肪族基, nは3以上の整数を表す)を反応させて得られるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体にある。

【0007】さらにはシリコン系ブロック共重合体からなる選択透過膜もしくはシリコン系ブロック共重合体を、厚さ方向に連続した微細孔を有する多孔膜の表面に設けた複合膜にある。

【0008】一般式(1)で示されるシロキサジオールのR<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>は好しくは炭素数1~5の炭化水素基である。

【0009】一般式(1)又は(2)で示される化合物でlもしくはmは好しくは10~2000、より好しくは10~60の整数である。8未満の場合は透過速度係数が低くなって好しくない。

【0010】一般式(3)で示されるジソシアネート化合物としては、例えばテトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、m-キシレンジイソシアネート、p-フェニレンジイソシアネート、4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート等が挙げられる。

【0011】一般式(4)で示される分子末端にヒドロキシル基を有するカーボネートジオールのnは好しくは5~25の整数である。nが3未満の場合は、製膜性がわるくなり好しくない。

【0012】本発明において、分子末端にカルビノール基もしくはヒドロキシル基を有するシロキサジオールと、分子末端にヒドロキシル基を有するカーボネートジオールとの反応生成物におけるシロキサンの割合は、20~80wt%の範囲にあることが好しく、より好しくは40~60wt%の範囲である。80wt%を超えて、シロキサジオールを混合した場合は、製膜性がわ

るくなるので好しくない。又20wt%未満の場合は、気体透過係数が低くなるので好しくない。

【0013】本発明におけるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体は、下記の方法により製造することができる。まず有機溶媒中にジソシアネート化合物を溶解し、窒素気流中で分子末端にカルビノール基又はヒドロキシル基を有するシロキサジオールを2時間反応させ、分子末端にイソシアネートを有する中間生成物を得る。

【0014】反応温度は60℃から90℃より好しくは70℃から80℃の範囲が良い。触媒としてはジラウリン酸ジブチル錫又は錫シオクテート等およびトリエチルアミン等の公知の触媒が用いられる。

【0015】次いで分子末端にヒドロキシル基を有するカルボジオールを加えて反応させ、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を得ることができる。

【0016】本発明におけるウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体の製造に用いられる有機溶媒の例としては、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジオキサソラン、テトラヒドロフラン等あるいはこれらとN-メチル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジエチルホルムアミドとの混合溶剤が用いられる。

【0017】このようにして得られたウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体は、公知の方法により平膜、管状膜、中空糸膜に製膜される。例えば、本発明の共重合体を適当な溶剤に溶解した高分子溶液あるいは重合溶液をそのままガラス板上に流延し、溶媒を蒸発させることにより、非多孔質の選択透過平膜を得ることが可能である。

(4)

特開平5-279447

5

【0018】又中空糸等の多孔質膜に該共重合体の高分子溶液あるいは重合溶液をコーティングすることにより、多孔質膜表面に分離機能を有する複合膜を得ることができる。

【0019】

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明する。

「部」は任意部をあらわす。

実施例1

4、4'-ジフェニルメタンジイソシアネート10、1部を70℃のテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒100部に溶解し、窒素気流中にて数平均分子量1000の(3-オキサヘキサノール)ジメチルシロキサン20部とジラウリン酸ジブチル錫、トリエチルアミン0.15wt%をテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒120部に溶解したものを添加して、2時間攪拌した。

【0020】次いで平均分子量1000の1、6-ヘキサノールカーボネートジオール20部をテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒150部に溶解したものを添加して18時間反応させた。得られた溶液を水、メタノールで洗浄し、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を80.4wt%の収率で得た。

【0021】実施例2

4、4'-ジフェニルメタンジイソシアネート10、1部を70℃のテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒150部に溶解し、窒素気流中にて、数平均分子量1800の(3-オキサヘキサノール)ジメチルシロキサン36部とジラウリン酸ジブチル錫、トリエチルアミン0.15wt%をテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒12\*

6

\*0部に溶解したものを添加して、3時間攪拌した。

【0022】次いで平均分子量2000の1、6-ヘキサノールカーボネートジオール40部をテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒200部に溶解したものを添加して20時間反応させた。得られた溶液を水、メタノールで洗浄し、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を75.9wt%の収率で得た。

【0023】実施例3

4、4'-ジフェニルメタンジイソシアネート10、1部を70℃のテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒200部に溶解し、窒素気流中にて、数平均分子量3200の(3-オキサヘキサノール)ジメチルシロキサン64部とジラウリン酸ジブチル錫、トリエチルアミン0.15wt%をテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒120部に溶解したものを添加して、4時間攪拌した。

【0024】次いで平均分子量2000の1、6-ヘキサノールカーボネートジオール40部をテトラヒドロフランとN、N'-ジメチルアセトアミドの混合溶媒200部に溶解したものを添加して24時間反応させた。得られた溶液を水、メタノールで洗浄し、ウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体を71.5wt%の収率で得た。

【0025】実施例4

実施例1~3で調製した共重合体をアセトンに溶解し、ガラス板上に流延しアセトンを蒸発させることにより120μmの厚みの均質なフィルムを作製した。このフィルムを用いて、酸素ガス及び窒素ガスの透過係数を測定したところ、表1のような結果であり、極めてガス透過性に優れるものであった。

【表1】

No	共重合体	ジメチルシロキサン含有率(%)	酸素ガス透過係数(cc·cm/cm <sup>2</sup> ·sec·cmHg)	分離係数(O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> )
a	実施例1調製品	32.0	3.0×10 <sup>-3</sup>	2.2
b	実施例2	37.6	6.1×10 <sup>-3</sup>	2.2
c	実施例3	53.1	1.5×10 <sup>-3</sup>	2.0

【0026】実施例5

ポリプロピレン多孔質中空糸膜(内径200μm、膜厚25μm、平均孔径0.1μm)の膜上に実施例1で調製した共重合体をコーティングした。

【0027】酸素ガスの気体透過量を測定したところ、6.9×10<sup>-3</sup>cc/cm<sup>2</sup>·sec·cmHgで、酸素ガスと窒素ガスの分離係数は2.2であり、膜に欠陥

はなかった。気体透過量から計算される膜のコーティング厚みは、0.43μmであった。

【0028】

【発明の効果】本発明のウレタン結合を有するシリコン系ブロック共重合体は、気体の透過性能に優れかつ良好な制膜性と膜強度を保持するものであり、気体分離用途や浸透気化分離等に極めて有用な材料である。